

# Исследование влияния расстояния между кремниевыми пластинами на скорость СВЧ плазмохимического удаления фоторезистивных пленок

Бельский Д. В. <sup>1</sup>,

Мадвейко С. И. <sup>2</sup>,

Бордусов С. В. <sup>3</sup>,

Тихон О. И. <sup>4</sup>,

Лушакова М. С. <sup>5</sup>

2018

1, 2, 3, 4, 5 Кафедра электронной техники и технологии,  
Белорусский государственный университет информатики и  
радиоэлектроники, Минск, Беларусь

**Ключевые слова:** СВЧ, фоторезистивные пленки, туннельный реактор.

**Аннотация.** Полученные результаты измерений структуры распределения СВЧ поля в зоне газового разряда в резонаторе прямоугольной формы указывают на существование устойчивой формы неравномерности распределения плотности мощности в объеме разрядной зоны. Это свидетельствует о наличии существенной пространственной неоднородности в параметрах

СВЧ разряда применительно к цилиндрическим разрядным камерам туннельного типа.

**Источник публикации:**

Приборостроение – 2018: материалы 11-й Международной научно-технической конференции, г. Минск, 14-16 ноября 2018 г. – Минск, 2018. – С. 240-241.